

(様式2)
議事録番号

提出 H18年 7月 7日

会合議事録

グループ名:「赤外光励起による新物質プロセッシング」

日時:7月1日(土) 13:30~20:00

場所:SPring8 中央管理棟1階 特別会議室

出席者:(議事録記載者に下線)

白井 光雲 大阪大学産業科学研究所

金田 寛 富士通株式会社

須藤 彰三 東北大学大学院理学研究科物理学専攻

根本裕一 新潟大学大学院自然科学研究科

松川 和人 ルネサステクノロジー株式会社

末岡 浩治 岡山県立大学 情報工学部 情報システム工学科

深田 直樹 物質材料研究機構 半導体材料センター半導体特性評価グループ

上浦 洋一 岡山大学大学院自然科学研究科

シャバニー株式会社 SUMCO

池本 夕佳 SPring8

森脇 太郎 SPring8

谷 正彦 大阪大学レーザーエネルギー学研究所

篠塚 雄三 和歌山大学

出倉 春彦 大阪大学産業科学研究所

山口 宏信 大阪大学産業科学研究所

佐藤 公秦 岡山大学大学院自然科学研究科

井上 直久 大阪府立大学先端研究所

計 18 名

議題：「キックオフ会議」

議事内容：

本研究会は、赤外光を物質合成に活用する事を目指してH18年度に新たに発足したものである。メンバーとして応用物理学会や、物理学会で主に半導体の格子欠陥を研究している研究者を中心としつつ、広い範囲に呼びかけているものである。本会議は、発足にあたりその趣意を確認する事、メンバーの研究を持ち寄り、今後2年間の活動方向を議論すること、を意図して開催された。また今後この分野の研究の広がりを模索するため、電子励起の分野、およびテラヘルツ領域の研究者にも講演していただき、交流を深めることも意図している。

会議は18名の参加があった。呼びかけをしたのが開催の2週間前であったため、メンバーでも出席できなかった人もおり、その事を考えるとまあまあの参加であったと思われる。会議は今後の方針を定めるための題材作りという意味合いもあり、議論は白熱し、予定の時間が大幅に遅れ、一部講演を短縮せざるを得ない状況になった。またSPring-8は初めてという人も多く、現地見学も実施し非常に有意義であった。講演の内容に関しては別紙の講演集を参考にさせていただく。

プログラム

・ 13 : 30 - 13 : 45

白井 光雲 (大阪大学) 基調報告

・ 13 : 45 - 14 : 10 (招待講演)

篠塚 雄三 (和歌山大学)「電子励起を用いた原子分子操作」

・ 14 : 10 - 14 : 25

末岡 浩治 (岡山県立大学) 「CZ-Si単結晶における酸素拡散と酸素析出物成長に与える添加元素の影響」

・ 14 : 25 - 14 : 40

シャバニー (株SUMCO) 「Determination of Effective Diffusion Coefficient of Cu in Silicon Diffusion from Bulk into the Polysilicate」Backsi

・ 14 : 40 - 15 : 00

根本 祐一 (新潟大学)「超音波によるシリコン結晶中の原子空孔直接観測」

・ 15 : 00 - 15 : 55

森脇 太郎、池本 夕佳 (JASRI)「赤外ビームラインの紹介とその研究例」
ビームラインの見学

・ 15 : 55 - 16 : 00

休憩

・ 16 : 00 - 16 : 25 (招待講演)

谷 正彦 (阪大、レーザー研) 長島健、萩行正憲 「テラヘルツパルス分光とその応用」

・ 16 : 25 - 16 : 40

上浦 洋一 (岡山大学) 「局所振動励起による水素・酸素局所運動の制御」

・ 16 : 40 - 16 : 55

須藤 彰三 (東北大学) 「炭酸ガスレーザー照射によるSi(100)表面の酸化膜成長過程とボロンの拡散」

・ 16 : 55 - 17 : 10

金田 寛 (富士通) 「赤外レーザーによる不純物振動励起を利用した次世代半導体基盤技術：不純物拡散と酸素析出制御」

・ 17 : 10 - 17 : 25

深田 直樹 (物質材料研究機構) 「1次元Siナノ細線へのキャリアドーピング」

・ 17 : 25 - 17 : 40

松川 和人 (ルネサステクノロジー株) 「結晶欠陥制御と不純物挙動解析」

・ 17 : 40 - 17 : 45

白井 光雲 (大阪大学) 「まとめと提案」

懇親会： 萌光館、 18 : 00 ~ 20 : 00

幹事会 宿舎、 20 : 00 ~ 21 : 00